(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年10月16日(16.10.2003)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 03/086013 A1

H04R 19/01

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/04328

(22) 国際出願日:

2003 年4 月4 日 (04.04.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-103300

2002年4月5日(05.04.2002) JP (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

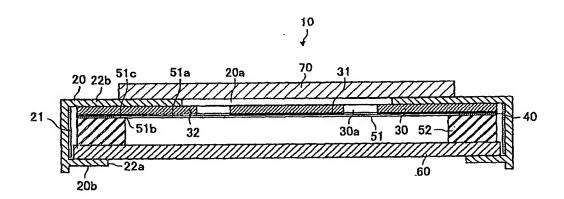
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平本 雅祥 (HI-RAMOTO,Masayoshi) [JP/JP]; 〒226-0015 神奈川県 横 浜市 緑区三保町 2 0 5 6 M 2 0 3 Kanagawa (JP). 土 井 -素 (DOI, Kazumoto) [JP/JP]; 〒224-0054 神奈川県 横浜市 都筑区佐江戸町 7 4 9-1 Kanagawa (JP). 安 野功修 (YASUNO, Yoshinobu) [JP/JP]; 〒166-0015 東 京都 杉並区 成田東 2-2-1 3 Tokyo (JP). 澤田 龍宏

/続葉有/

(54) Title: CAPACITOR SENSOR

(54) 発明の名称: コンデンサセンサ



(57) Abstract: A capacitor sensor (10) comprises an electrically conductive case (20) having an opening (22a) and a section (22b) opposed to the opening (22a), a fixed electrode (30) received in the electrically conductive case (20) through the opening (22a), an electrically conductive vibration membrane (51) received in the electrically conductive case (20) and disposed in the opening (22a) in spaced relation to the fixed electrode (30), an electrically conductive vibration membrane holder (52) received in the electrically conductive case (20) for holding the vibration membrane (51), a circuit packaging substrate (60) received in the electrically conductive case (20) and electrically connected to the fixed electrode (30) and vibration membrane (51) through the electrically conductive case (20) and vibration membrane holder (52), respectively, and a deformation inhibitor (32) for inhibiting deformation of the opposed portion (22b), wherein the deformation inhibitor (32) is disposed between the electrically conductive case (20) and the vibration membrane (51) and inwardly of the outer periphery (51b) of the vibratable portion (51a) of the vibration membrane (51).

(57) 要約: コンデンサセンサ(10)は、開口部(22a)及び開口部(22a)に対向した対向部(22b)を有した導電性ケース(20) と、開口部(22a)を介して導電性ケース(20)の内部に収納された固定電極(30)と、導電性ケース(20)の内部に収納され 開口部(22a)側に固定電極(30)と離隔して配置された導電性の振動膜(51)と、導電性ケース(20)の内部に収納され振動 膜(51)を保持した導電性の振動膜保持部(52)と、導電性ケース(20)の内部に収納され固定電極(30)及び振動膜(51)とそれぞれ導電性ケース(20)及び振動膜保持部(52)を介して電気的に接続された回路実装基板(60)と、対向部(22b)の変形 を抑制する変形抑制部(32)とを備え、変形抑制部(32)は、導電性ケース(20)及び振動膜(51)の間であって振動膜(51)の 振動可能な部分(51a)の外周(51b)より内側に配置され

/続葉有/

(SAWADA,Tatsuhiro) [JP/JP]; 〒224-0054 神奈川県 横浜市 都筑区佐江戸町 7 4 9-1 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 有我 軍一郎 (ARIGA,Gunichiro); 〒151-0053 東京都 渋谷区 代々木二丁目 6番 9 号 第 2 田中ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明細書

コンデンサセンサ

技術分野

5 本発明は、マイクロホンや振動センサなどとして使用されるコンデン サセンサに関する。

背景技術

従来、特開2001-145196号公報に記載されているように、 9電性カプセルと、導電性カプセルに収納され周縁に周縁リング部が形成された導電性補強板と、導電性カプセルに収納され導電性補強板と離隔して配置された導電性振動膜とを備え、導電性補強板の周縁リング部が導電性カプセルに係合することによって導電性カプセル及び導電性補強板の間に間隙が形成されたコンデンサマイクロホンがコンデンサセン サとして知られている。

そして、従来のコンデンサマイクロホンは、導電性カプセルのうち比較的変形し難い部分に対向した周縁リング部のみで導電性補強板が導電性カプセルに係合することによって、導電性カプセルの変形が導電性補強板に伝達することを抑制していた。

20 また、従来のコンデンサマイクロホンは、導電性カプセル及び導電性 補強板の間に形成された間隙において導電性カプセルの変形を積極的に 許容することによっても、導電性カプセルの変形が導電性補強板に伝達 することを抑制していた。

しかしながら、上述した従来のコンデンサマイクロホンにおいては、 25 導電性カプセルの変形を積極的に許容していたので、導電性カプセルの 変形に伴って導電性カプセル内の空間も変形し、周波数特性が悪くなる

という問題があった。

そこで、本発明は、周波数特性の悪化を抑制することができるコンデ ンサセンサを提供することを目的とする。

5 発明の開示

本発明のコンデンサセンサは、開口部及び前記開口部に対向した対向部を有した導電性ケースと、前記開口部を介して前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極と、前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極より前記開口部側に前記固定電極と離隔して配置された導電性の振動膜と、前記導電性ケースの内部に収納され前記振動膜を保持した導電性の振動膜保持部と、前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極及び前記振動膜とそれぞれ前記導電性ケース及び前記振動膜保持部を介して電気的に接続された回路実装基板と、前記対向部の変形を抑制する変形抑制部とを備え、前記変形抑制部は、前記導電性ケース及び前記振動膜の間であって前記振動膜の振動可能な部分の外周より内側に配置された構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、対向部の変形を抑制するので、対向部の変形による周波数特性の悪化を抑制することができる。

20 また、本発明のコンデンサセンサは、前記固定電極及び前記変形抑制 部は、一体に形成された構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、固定電極及び変形抑制部が別部品である場合と比較して、部品点数を少なくすることができる。

25 また、本発明のコンデンサセンサは、前記振動膜は、導電性物質が積 層された樹脂フィルムを有した構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、振動膜が金属のみで、 形成された場合と比較して振動膜を軽量化することができので、振動膜 が金属のみで形成された場合と比較して感度を向上することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記振動膜保持部は、導電体及 び絶縁体の複合体である構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、振動膜保持部が導電体のみで形成されている場合と比較して、導電性ケース及び振動膜の間の浮遊容量を低下させることができ、感度を向上することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記導電性ケース及び前記固定 10 電極は、それぞれ音孔が形成され、前記導電性ケースの前記音孔の総面 積は、前記固定電極の前記音孔の総面積より大きく、前記固定電極の前 記音孔の総面積は、前記振動膜の振動可能な部分の総面積の1/100 0より大きく1/10より小さい構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、十分な音圧を振動膜 15 に伝えることができ、十分な感度を得ることができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記振動膜の厚みは、1 μ m より大きく3 μ m より小さい構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、髙感度と髙歩留まり を両立することができる。

20 また、本発明のコンデンサセンサは、前記振動膜の基本共振周波数は、 10KHzより大きく35KHzより小さい構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、髙感度と髙歩留まり を両立することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記固定電極に付されたエレク 25 トレット材を備え、前記エレクトレット材の厚みは、3 μ m より大きく 2 5 μ m より小さい構成を有している。

10

15

20

25

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、高感度と高歩留まり を両立することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記導電性ケースに取り付けられて前記導電性ケースと電気的に接続された導電性面布を備え、前記導電性ケース及び前記固定電極は、それぞれ音孔が形成され、前記導電性ケースの音孔は、前記導電性面布によって覆われた構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、導電性ケースの外部 の電磁ノイズが導電性ケースの音孔を介して導電性ケースの内部に侵入 することを抑制することができるので、導電性ケースの外部の電磁ノイ ズが振動膜に到達することを抑制することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記導電性面布は、導電性物質 及び非導電性物質の複合体である構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、導電性面布が導電性物質のみで形成されている場合と比較して、導電性面布の製造を容易化することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記導電性ケース及び前記固定電極の間に配置された導電性スペーサを備え、前記導電性ケース及び前記固定電極は、それぞれ音孔が形成された構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、導電性ケース及び固 定電極が互いに直接接触している場合と比較して、導電性ケースの音孔 が形成された面から固定電極までの距離が長いので、導電性ケースの外 部の電磁ノイズが振動膜に到達することを抑制することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記固定電極の前記音孔の少なくとも一部は、前記導電性ケースの前記音孔以外の部分と対向した構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、固定電極の音孔の全

部が導電性ケースの音孔と対向している場合と比較して、導電性ケース の外部の電磁ノイズが振動膜に到達することを抑制することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記固定電極は、前記振動膜と 外周部の形状が異なる構成を有している。

5 この構成により、本発明のコンデンサセンサは、固定電極が振動膜と 外周部の形状が同じ場合と比較して、振動膜の振動可能な部分以外の部 分と固定電極との間の浮遊容量を低下させることができ、出力電圧を向 上することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記導電性ケースの前記振動膜 10 保持部側の面に付された絶縁部を備えた構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、絶縁部が導電性ケースとは独立している場合と比較して、部品点数を減らすことができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記導電性ケース及び前記振動 膜保持部の間に絶縁部を備え、前記絶縁部は、前記導電性ケースとは独 立している構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、絶縁部が導電性ケースに付された場合と比較して、簡単な構造であるので、容易に製造されることができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記絶縁部は、金属の母材と、 20 前記母材の表面に施された絶縁材料との複合体である構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、絶縁部が絶縁材料の みによって形成されている場合と比較して、絶縁部の剛性を向上するこ とができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記振動膜保持部と前記回路実 25 装基板との間に配置された導電性部材を備え、前記回路実装基板は、前 記導電性部材を介して前記振動膜保持部と電気的に接続された構成を有 している。

10

25

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、導電性部材によって 高さの調整を容易化することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、外部の機器と電気的に接続可能 な端子と、前記端子に電気的に接続されノイズを除去するノイズ除去部 とを有し、前記ノイズ除去部は、前記回路実装基板に実装された構成を 有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、外部の機器と電気的に接続可能な端子を通じて外部から入力されるノイズを除去することができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記端子に電気的に接続され前記回路実装基板に実装されたパリスタ素子を備えた構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、耐ESD(静電気放電)性を向上することができる。

15 また、本発明のコンデンサセンサは、前記回路実装基板の内部に埋め 込まれた素子を備えた構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、素子が回路実装基板上に実装される場合と比較して、回路実装基板と振動膜との間隔を小さくすることができる。

20 また、本発明のコンデンサセンサは、印刷及び薄膜プロセスの少なくとも一方によって前記回路実装基板上に形成された素子を備えた構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、素子が半田で回路実装基板上に実装される場合と比較して、回路実装基板と振動膜との間隔を小さくすることができるので、高さを低くすることができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記回路実装基板上に実装され

10

15

20

7

たベアチップを備えた構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、チップがパッケージで回路実装基板上に実装された場合と比較して、回路実装基板と振動膜との間隔を小さくすることができるので、高さを低くすることができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、前記導電性ケースの前記固定電極側の面に付された絶縁部と、前記導電性ケース及び前記固定電極の間を電気的に接続した導通部とを有した構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、導電性ケースの固定電極側の面に付された絶縁部が除去されなくても導電性ケース及び固定電極が互いに導通されるので、導電性ケースの固定電極側の面に付された絶縁部が除去されることによって導電性ケース及び固定電極が互いに導通される場合と比較して、容易に製造されることができる。

また、本発明のコンデンサセンサは、互いに対向した一対の開口部を 有した導電性ケースと、前記開口部を介して前記導電性ケースに圧入さ れた固定電極と、前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極と離 隔して配置された導電性の振動膜と、前記導電性ケースの内部に収納さ れ前記振動膜を保持した導電性の振動膜保持部と、前記導電性ケースの 内部に収納され前記固定電極及び前記振動膜とそれぞれ前記導電性ケー ス及び前記振動膜保持部を介して電気的に接続された回路実装基板とを 備えた構成を有している。

この構成により、本発明のコンデンサセンサは、導電性ケースの変形 による周波数特性の悪化を抑制することができる。

図面の簡単な説明

25 本発明に係るコンデンサセンサの特徴及び長所は、以下の図面と共に、 後述される記載から明らかになる。

図1は、本発明の第1の実施の形態に係るコンデンサセンサの側面断面図である。

図 2 は、図 1 に示す例とは異なる例での図 1 に示すコンデンサセンサの側面断面図である。

5 図3(a)は、図1に示すコンデンサセンサの回路図であり、図3(b)は、図1に示すコンデンサセンサの実効容量と、固定電極及び振動膜の間の浮遊容量と、FET(電界効果トランジスタ)の入力容量との関係式を示す図である。

図4 (a) ~ (f) は、図1に示すコンデンサセンサの固定電極の平 10 面図である。

図 5 (a) ~ (c) は、図 4 (a) ~ (f) に示す例とは異なる例での図 1 に示すコンデンサセンサの固定電極の平面図である。

図6(a)は、図1に示すコンデンサセンサの振動膜及び振動膜保持部の上面図であり、図6(b)は、図1に示すコンデンサセンサの振動膜及び振動膜保持部の下面図である。

図7は、図3 (a) に示す例とは異なる例での図1に示すコンデンサセンサの回路図である。

図8は、図1に示すコンデンサセンサの実験結果を示す図である。

図 9 は、図 1 に示すコンデンサセンサの図 8 に示す実験結果とは異な 20 る実験結果を示す図である。

図10は、図1に示すコンデンサセンサの図8及び図9に示す実験結果とは異なる実験結果を示す図である。

図11は、図1に示すコンデンサセンサがマイクロホンとして使用されるときの図1に示すコンデンサセンサの正面図である。

25 図12 (a) は、図1に示すコンデンサセンサの回路実装基板に実装 されるFETの裏面図であり、図12 (b) は、図12 (a) に示す例 とは異なる例での図1に示すコンデンサセンサの回路実装基板に実装されるFETの裏面図である。

図13(a)~(h)は、図1に示すコンデンサセンサの回路実装基板の所定の製造工程における側面図である。

5 図14(a)~(e)は、図13に示す例とは異なる例での図1に示すコンデンサセンサの回路実装基板の所定の製造工程における側面図である。

図15は、図13及び図14に示す例とは異なる例での図1に示すコンデンサセンサの回路実装基板の側面断面図である。

10 図16は、図3(a)及び図7に示す例とは異なる例での図1に示す コンデンサセンサの回路図である。

図17は、本発明の第2の実施の形態に係るコンデンサセンサの側面 断面図である。

図18は、本発明の第3の実施の形態に係るコンデンサセンサの側面15 断面図である。

図19は、本発明の第4の実施の形態に係るコンデンサセンサの側面断面図である。

図20は、本発明の第5の実施の形態に係るコンデンサセンサの側面断面図である。

20 図21は、図20に示すコンデンサセンサの導電性ケースの平面図である。

図22は、本発明の第6の実施の形態に係るコンデンサセンサの側面断面図である。

図23は、本発明の第7の実施の形態に係るコンデンサセンサの側面 25 断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。

(第1の実施の形態)

まず、第1の実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデン 5 サセンサの構成について説明する。

図1に示すように、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型の コンデンサセンサ 1 0 は、 開口部 2 2 a 及び開口部 2 2 a に対向した対 向部22bを有し音孔20aが形成された導電性ケース20と、導電性 ケース20の内部側の面に付された絶縁部21と、導電性ケース20の 内部に導電性ケース20と接触して配置された固定電極30と、固定電 10 極30の導電性ケース20との接触面側とは反対側の面上に積層された エレクトレット材31と、導電性ケース20の内部にエレクトレット材 31と接触して配置されたスペーサ40と、導電性ケース20の内部に スペーサ 4 0 と 接触 して 固定 電 極 3 0 よ り 導電性 ケース 2 0 の 開 口 部 2 2 a 側に配置された振動膜 5 1 と、導電性ケース 2 0 の内部に配置され 15 て振動膜51を保持する振動膜保持部52と、導電性ケース20の内部 に振動膜保持部52と接触して配置されて導電性ケース20の内部を覆 う回路実装基板60と、導電性ケース20の外部から導電性ケース20 の音孔20aを覆う導電性面布70とを備えている。

20 なお、コンデンサセンサ10は、図2に示すように、振動膜保持部5 2及び回路実装基板60の間に導電性部材53を備えることによって、 高さの調整を容易化することができる。以下においては、コンデンサセ ンサ10が導電性部材53を備えている構成によってコンデンサセンサ 10について説明する。

25 ここで、導電性ケース 2 0 は、アルミ、洋泊、 S U S など工業上比較 的安価で耐腐食性が高く、かつ導電率が高い金属によって形成されてい

ることが望ましい。なお、その金属の表面は、さらに導通性や防食性を 高める目的で金メッキなどがされていても良い。

また、絶縁部21は、加工や整形の容易さと、コンデンサセンサ10 の感度に無関係な浮遊容量を減少させることの必要性とから、比較的低 誘電率である樹脂、又は、樹脂と金属との複合体によって形成されてい 5 ることが好ましい。例えば、絶縁部21は、導電性ケース20に融着さ れ、又は、塗布されたPET (ポリエチレンテレフタレート)、PP (ポ リプロピレン)、PEN (ポリエチレンナフタレート)、FEP (ポリフ ッ化エチレンプロピレン)などの樹脂フィルムでも良いし、エポキシ系 などの接着剤でも良い。ここで、樹脂の誘電率は空隙の誘電率よりも一 10 般に大きいので、導電性ケース20と振動膜保持部52及び導電性部材 53との電気的、物理的な接触がなければ、絶縁部21は、様々な厚み や配置をとることができる。例えば、絶縁部21は、導電性ケース20 の内面に部分的に塗布されることによって、分散した配置をとっても良 い。ただし、絶縁部21は、導電性ケース20と振動膜保持部52及び 15 導電性部材53との浮遊容量を小さくする厚みや配置をとることが好ま しい。

なお、絶縁部21が付された導電性ケース20は、例えば、絶縁部2 1になる絶縁樹脂が融着され、又は、塗布された積層金属シートをケース形状に絞り加工した後、導電性ケース20の音孔20aが形成された面上の絶縁樹脂を、プラスト工法などを適用して除去することで容易に製造されることができる。

また、固定電極30は、音孔30aが形成されている。ここで、導電性ケース20の音孔20aの総面積は、外部からの音圧の反射や共振を 25 抑制するために固定電極30の音孔30aよりも大きいことが望ましい。 例えば、コンデンサセンサ10がマイクロホンとして使用される場合、

10

15

20

25

固定電極30の音孔30aの総面積は、振動膜51のうち振動膜保持部52によって固定されていない振動可能な部分(以下「可振部」という。)51aの総面積に対して、1/10よりも小さく、1/1000よりも大きいことが望ましい。即ち、固定電極30の音孔30aの総面積が振動膜51の可振部51aの総面積に対して1/10より大きいとき、固定電極30及び振動膜51の間の実効的な容量が低下するので、コンデンサセンサ10は十分な感度が得られにくい。また、固定電極30の音孔30aの総面積が振動膜51の可振部51aの総面積に対して1/100よりも小さいとき、コンデンサセンサ10は十分な音圧を振動膜51に伝えることができない。なお、コンデンサセンサ10が振動センサとして使用される場合、音圧の導入を必要としないため、この限りではない。

また、固定電極30は、導電性ケース20の対向部22bの変形を抑制する変形抑制部32を振動膜51の可振部51aの外周51bより内側に有している。したがって、コンデンサセンサ10は、対向部22bの変形による周波数特性の悪化を抑制することができる。なお、コンデンサセンサ10は、固定電極30及び変形抑制部32が一体に形成されているので、固定電極30及び変形抑制部32が別部品である場合と比較して、部品点数を少なくすることができるが、固定電極30及び変形抑制部32が別部品である構成であっても良い。

また、固定電極30は、SUSや、Niメッキなどの防食処理を施した真鍮、洋泊などの金属によって形成されていることが望ましく、その金属の表面は、さらに導通性や防食性を高める目的で金メッキなどがされていても良い。なお、コンデンサセンサ10は、固定電極30を導電性ケース20と比較して曲げ強度が強い材料によって形成することができるので、薄型化、小型化における強度安定性を容易に実現することが

できる。

5

10

また、エレクトレット材31は、FEPによって形成されていることが望ましく、塗布、又は、フィルムの熱融着などで固定電極30に接合されている。また、エレクトレット材31は、固定電極30が導電性ケース20の内部に挿入される前に、予め電子ビーム又はコロナ放電などで着電されることによって高い着電電位を得ている。

また、スペーサ40は、PET、PP、PPS(ポリフェニレンサルファイド)、PENなど絶縁性が高く、比較的吸湿性が少なく、また塑性変形、応力破壊などがし難く、かつ加工性の優れた樹脂によって形成されていることが好ましい。

また、振動膜51は、導電性と耐食性を併せ持つAu、Pt、Tiな どによって形成されていても良いが、導電性髙分子フィルム、又は、P ET、PP、PPS、PENなどの絶縁性の樹脂フィルムに導電性物質 であるAu、Ni、Pt、Ti、V、W、Taなどを例えば真空蒸着法 やスパッタリング法を用いて積層化したものによって形成されている方 15 が好ましい。振動膜51は、導電性物質が積層された樹脂フィルムによ って形成されている場合、金属のみで形成されている場合と比較して軽 量化することができので、金属のみで形成されている場合と比較してコ ンデンサセンサ10の感度を向上することができる。なお、振動膜51 は、振動膜保持部52と電気的に導通を持つように配置されている。例 20 えば、振動膜51は、上述したように絶縁性樹脂フィルムと金属とを多 **屬化したものによって形成されている場合、金属蒸着面と振動膜保持部** 5 2 とがエポキシ系接着剤などで接合されることによって、容易に導通 を確保することができる。

25 また、振動膜保持部 5 2 は、振動膜 5 1 のテンションを一定に保つ目 的で、機械的強度が高いことが望ましく、特に S U S 、 洋泊、真鍮など の金属や、金属と樹脂などの複合体によって形成されていることが好ま しい。

また、導電性部材53は、振動膜保持部52と同様に、金属や、金属と樹脂などの複合体によって形成されていることが好ましい。

5 なお、導電性ケース20と、振動膜保持部52及び導電性部材53と は、絶縁部21の他に空隙が介在することによって、互いの直接的な導 通が行われないようになっている。

また、回路実装基板60は、JFET(接合型電界効果トランジスタ) 又はMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)などの図 示していないインピーダンス変換素子や増幅回路が導電性ケース20の 10 内部側に配置されており、導電性部材53側にパターンとして出された インピーダンス変換素子のゲートで導電性部材53と電気的に接続して おり、導電性部材53側とは反対側にパターンとして出されたインピー ダンス変換素子のソースで導電性ケース20の一部20bと電気的に接 続している。したがって、固定電極30及び振動膜51の間の容量の変 15 化に伴う電位の変化は、インピーダンス変換素子のドレイン及びソース の間の抵抗値の変化として検出することができる。なお、回路実装基板 60は、図示しているようにカーリングやカシメで導電性ケース20の 一部20bに圧接されることによって、インピーダンス変換素子のソー スで遵電性ケース20の一部20bと電気的に接続することもできるが、 20 超音波接合や溶接などを用いてインピーダンス変換素子のソースで導電 性ケース20の一部20bと電気的に接続することもできる。

なお、導電性面布70は、導電性ケース20の音孔20aからのダストの進入を阻止することができるだけではなく、導電性ケース20の外25 部の電磁ノイズが導電性ケース20の音孔20aを介して導電性ケース20の内部に侵入することを抑制することができるので、導電性ケース

10

15

20

25

上させることができる。

20の外部の電磁ノイズが振動膜51に到達して振動膜51に影響する ことを抑制することができる。

また、導電性面布 7 0 は、例えば金属繊維や、樹脂繊維にカーボンやメッキなどを施した複合繊維や、樹脂繊維と金属繊維との複合体や、樹脂繊維中に金属フィラーなどを複合させたものによって形成されていても良い。更に、導電性面布 7 0 は、非導電性面布にスパッタリングや真空蒸着、メッキなどを用いて、導通面を積層させたものによって形成されていても良い。導電性面布 7 0 は、導電性物質及び非導電性物質の複合体である場合、導電性物質のみで形成されている場合と比較して容易に製造されることができる。

なお、導電性ケース20及び導電性面布70は、樹脂系接着剤や導電性がある両面テープなどで互いに接合されることによって容易に導通されることができる。また、導電性面布70は、導電性ケース20との接合面とは反対側の面にフッ素系化合物を用いた防水処理を施しても良い。

なお、コンデンサセンサ10は、図1及び図2において断面構造のみが示されているが、円柱や四角柱などの様々な形状をとることができる。

また、コンデンサセンサ10は、例えばインピーダンス変換素子としてFETを用いる場合、図3(a)に示すように、外部の機器と電気的に接続可能な端子10aと、FET及びダイオードを集積し回路実装基板60に実装されたICチップ10bと、固定電極30及び振動膜51で構成されたコンデンサ10cとを備えた回路を構成する。そして、コンデンサセンサ10の実効容量(Ceff)と、固定電極30及び振動膜51の間の浮遊容量(Cs)と、FETの入力容量(Ciss)との間には、図3(b)に示すような関係が成立すると考えられる。即ち、コンデンサセンサ10は、浮遊容量を低下させることで、出力電圧を向

例えば、コンデンサセンサ10が円柱の形状をとって振動膜51の形 状が円形である場合、固定電極30は、図4に示すような形状をとるこ とによって振動膜51との間の浮遊容量を低下させることができる。図 4 (a) に示す固定電極30は、形状が円形であり、3つの音孔30 a が形成されている。これに対し、図4(b)に示す固定電極30は、外 5 周部が削られて削除部30bが設けられることで振動膜51と外周部の 形状が異なり、振動膜51の可振部51a以外の部分(以下、「非可振部」 という。) 51 c (図1参照) との間の浮遊容量を低下させた構造になっ ている。この固定電極30の削除部30bは、振動膜51の可振部51 aに対向する面に到達するようになっていても良い。例えば、図4(c) 10 に示す固定電極30は、振動膜51の可振部51aに対向する面に削除 部30bを到達させて削除部30bの一部を音孔とし、削除部30bの 一部を介して導電性ケース20側から振動膜51側に音圧を導入可能に することによって、中心部の音孔30a(図4(b)参照)を無くした 構造になっている。なお、図4(a)に示す固定電極30の音孔30a 15 の総面積と、図4 (c) に示す固定電極30の削除部30bのうち導電 性ケース20側から振動膜51側に音圧を導入可能にしている部分の総 面積とが等しい場合、図4(c)に示す固定電極30は、振動膜51の 実効的な振動幅が大きい振動膜51の中心部に対向する位置に存在して いるので、振動膜51の中心部に対向する位置に音孔30aが形成され 20 ている図4 (a) に示す固定電極30と比較して、コンデンサセンサ1 0の感度を向上することができる。同様に、固定電極30は、図4(d) ~ (f) に示すような構造をとることも好ましい。

また、コンデンサセンサ10が四角柱の形状をとって振動膜51の形 25 状が四角形である場合、固定電極30は、図5に示すような形状をとる ことによって振動膜51との間の浮遊容量を低下させることができる。

10

15

図5 (a) に示す固定電極30は、形状が四角形であり、3つの音孔3 Oaが形成されている。これに対し、図5(b)に示す固定電極30は、 外周部が削られて削除部30bが設けられることで振動膜51と外周部 の形状が異なり、振動膜51の非可振部51cとの間の浮遊容量を低下 させた構造になっている。この固定電極30の削除部30bは、振動膜 51の可振部51aに対向する面に到達するようになっていても良い。 例えば、図5 (c) に示す固定電極30は、振動膜51の可振部51 a に対向する面に削除部30bを到達させて削除部30bの一部を音孔と し、削除部30bの一部を介して導電性ケース20側から振動膜51側 に音圧を導入可能にすることによって、中心部の音孔30a(図5(b) 参照)を無くした構造になっている。なお、図5 (a) に示す固定電極 30の音孔30aの総面積と、図5(c)に示す固定電極30の削除部 30bのうち導電性ケース20側から振動膜51側に音圧を導入可能に している部分の総面積とが等しい場合、図5 (c)に示す固定電極30 は、振動膜51の実効的な振動幅が大きい振動膜51の中心部に対向す る位置に存在しているので、振動膜51の中心部に対向する位置に音孔 30 a が形成されている図5 (a) に示す固定電極30 と比較して、コ ンデンサセンサ10の感度を向上することができる。

また、コンデンサセンサ10が円柱の形状をとって振動膜51の形状20 が円形である場合、振動膜保持部52は、図6に示すように、導電体52a及び絶縁体52bの複合体とすることで、導電体のみで形成されている場合と比較して、導電性ケース20との間の浮遊容量を低下させることができ、コンデンサセンサ10の感度を向上することができる。ここで、図6に示す振動膜保持部52は、絶縁樹脂と、金属との一体成型25 品などで容易に実現することができる。なお、導電性部材53も、振動膜保持部52と同様の構造をとって、導電性ケース20との間の浮遊容

量を低下させ、コンデンサセンサ10の感度を向上することができる。

なお、図7に示すように、FET、ダイオード、及び、FETのゲート上の過剰電荷を放出することによって出力応答性を高める働きをする 高抵抗R1を集積したICチップ10dと、容量性素子C及び抵抗素子 R2から成りFETのドレイン及びソースの間に接続されたノイズ除去 部としてのCRローパスフィルタ10eとを回路実装基板60が実装す るようになっていても良い。

コンデンサセンサ10は、FETのドレイン及びソースの間に接続されたCRローパスフィルタ10eを備えることによって、端子10aを10 通じて外部から入力されるノイズを除去することができる。また、コンデンサセンサ10は、FETのドレイン及びソースの間に接続されたCRローパスフィルタ10e以外にも、誘導性素子Lを用いたCRL、CL又はRL回路や、1つ以上の容量性素子Cのみによるバイパスコンデンサ回路をノイズ除去部として備えることによって、FETのドレイン及びソースの間のノイズを除去することができる。なお、端子10aを通じて外部から入力されるノイズとしては、例えばコンデンサセンサ10が携帯電話にコンデンサマイクロホンとして用いられるときに、携帯電話の電波によって受けるノイズがある。

更に、コンデンサセンサ10は、FETのドレイン及びソースの間に
20 パリスタ素子を備えることによって耐ESD性を向上することもできる。
なお、ICチップ10dの高抵抗R1は、例えば100MΩ以上20
GΩ以下が好ましく、特に1GΩ以上10GΩ以下が望ましい。また、
CRローパスフィルタ10eの容量性素子Cは、10PF以上10nF
以下が好ましく、抵抗素子R2は、10Ω以上1000Ω以下が好まし
25 い。

以上のように構成されているコンデンサセンサ10の具体的な実施例

について、最適な構造と特性について説明する。

(実施例1)

15

コンデンサセンサ10として、高さが1.4mm、形状が円柱で直径が6mmのコンデンサマイクロホンを作製した。ここで、導電性ケース20としては、板厚が0.12mmの洋泊を用い、絶縁部21としては、導電性ケース20になる洋泊に融着されたPETフィルムを用いた。また、固定電極30としては、厚みが0.2mmのSUS材に、厚みが12.5μmのFEPを積層し、280Vに着電したものを用いた。また、振動膜保持部52、導電性部材53としては、何れも厚みが0.3mmのSUS材を用いた。また、振動膜51としては、様々な厚みを持つPETフィルムに厚みが20nmのAu又は厚みが70nmのNiを蒸着したものを用い、スペーサ40としては、厚みが38μmのPETを用いた。それぞれコンデンサマイクロホンに組上げ、感度を測定した。

図 8 に示す結果のように、コンデンサセンサ 1 0 の感度の観点から振動膜 5 1 の P E T の膜厚には最適値があり、振動膜 5 1 の厚みが 1 μ m 以下においてはコンデンサセンサ 1 0 の感度にバラツキが大きかった。

したがって、振動膜 5 1 の厚みが 1 μ m より大きく 3 μ m より小さい ときに、コンデンサセンサ 1 0 が 高感度と高歩留まりを両立することが 判明した。

20 なお、振動膜 5 1 として P E T を用いた場合の他に、振動膜 5 1 として P P S、 P E N、 P P などのフィルムを用いた場合についても調べたが、振動膜 5 1 として P E T を用いた場合とほぼ同様の結果が得られた。 (実施例 2)

コンデンサセンサ10として、高さが1.4mm、形状が円柱で直径 25 が6mmのコンデンサマイクロホンを作製した。ここで、導電性ケース 20としては、板厚が0.12mmの洋泊を用い、絶縁部21としては、 WO 03/086013

5

20

25

導電性ケース 2 0 になる洋泊に融着された F E P フィルムを用いた。また、固定電極 3 0 としては、厚みが 0 . 2 m m の S U S 材に、厚みが 1 2 . 5 μ m の F E P を積層し、2 8 0 V に着電したものを用いた。また、振動膜保持部 5 2 、導電性部材 5 3 としては、何れも厚みが 0 . 3 m m の S U S 材を用いた。また、スペーサ 4 0 としては、厚みが 3 0 μ m の P P を用いた。また、振動膜 5 1 としては、厚みが 2 . 5 μ m の P P S フィルムに厚みが 2 0 n m の A u を蒸着したものを用い、振動膜保持部 5 2 への貼り付け張力を様々に変えたものをコンデンサマイクロホンに組上げ、振動膜 5 1 の基本共振周波数 f 0 と感度との関係を調べた。

10 図9に示す結果のように、コンデンサセンサ10の感度の観点から振動膜51の基本共振周波数f0には最適値があり、特に振動膜51の基本共振周波数f0が10KHz以下においてはコンデンサセンサ10の感度にバラツキが大きく、振動膜51の基本共振周波数f0がほぼ35KHz以上においてはコンデンサセンサ10は十分な感度が得られなかった。

したがって、振動膜 5 1 の基本共振周波数 f 0 が 1 0 K H z より大きく3 5 K H z より小さいときに、コンデンサセンサ 1 0 が高感度と高歩留まりを両立することが判明した。

なお、振動膜51としてPPSを用いた場合の他に、振動膜51としてPET、PEN、PPなどのフィルムを用いた場合についても調べたが、振動膜51としてPPSを用いた場合とほぼ同様の結果が得られた。
(実施例3)

コンデンサセンサ10として、高さが1.4mm、形状が円柱で直径が6mmのコンデンサマイクロホンを作製した。ここで、導電性ケース20としては、板厚が0.12mmの洋泊を用い、絶縁部21としては、 導電性ケース20になる洋泊に樹脂を塗布したものを用いた。また、固

定電極30としては、厚みが0.2mmのSUS材に、様々な厚みを持つFEPを積層したものを準備し、それぞれ280Vに着電した。また、振動膜保持部52、導電性部材53としては、何れも厚みが0.3mmのSUS材を用いた。また、振動膜51としては、厚みが1.5μmのPETフィルムに厚みが40nmのTiを蒸着したものを用いた。それぞれコンデンサマイクロホンに組上げ、固定電極30のFEPフィルムの厚みと感度との関係を調べた。

図10に示す結果のように、コンデンサセンサ10の感度の観点から 固定電極30のFEPの厚みには最適値があり、特に固定電極30のF 10 EPの厚みが3μm以下においてはコンデンサセンサ10の感度にバラ ツキが大きかった。

したがって、エレクトレット材31の厚みが3μmより大きく25μmより小さいときに、コンデンサセンサ10が高感度と高歩留まりを両立することが判明した。

15 (実施例4)

コンデンサセンサ10として、高さが約1.5 mm、形状が円柱で直径が4mmのコンデンサマイクロホンと、高さが約1.0 mm、形状が円柱で直径が6mmのコンデンサマイクロホンとを作製した。ここで、導電性ケース20としては、板厚0.12mmの洋泊を用い、絶縁部21としては、導電性ケース20になる洋泊に絶縁塗布加工を施したものを用いた。また、固定電極30としては、厚みが0.1 mmのSUS材に厚みが12.5 μmのFEPを積層し、200V~300Vに着電したものを用いた。また、振動膜保持部52、導電性部材53としては、何れも厚みが0.4 mmのSUS材を用いた。なお、高さが1.0 mm、25 形状が円柱で直径が6 mmのコンデンサマイクロホンには、導電性部材53を備えなかった。また、振動膜51としては、厚みが2.5 μmの

PETフィルムに厚みが70nmのNiを蒸着したものを用い、スペーサ40としては、厚みが38μmのPETを用いた。それぞれコンデンサマイクロホンに組上げ、感度を測定した。

測定の結果、高さが1.5 mm、形状が円柱で直径が4 mmのコンデンサマイクロホンでは、-48dB~-44dBという感度が得られ、高さが1.0 mm、形状が円柱で直径が6 mmのコンデンサマイクロホンでは、-45dB~-38dBという高感度が達成できた。また、これらのコンデンサマイクロホンの周波数特性は、20KHzまでほぽー様な値を示した。

10 (実施例5)

5

コンデンサセンサ10として、高さが1.5 mm、形状が円柱で直径が6 mmのコンデンサマイクロホンを作製した。ここで、導電性ケース20としては、板厚が0.12 mmの洋泊を用い、絶縁部21としては、導電性ケース20になる洋泊に絶縁塗布加工を施したものを用いた。また、固定電極30としては、厚みが0.1 mmのSUS材に厚みが12.5μmのFEPを積層し、200V~300Vに着電したものを用いた。また、振動膜保持部52、導電性部材53としては、何れも厚みが0.4mmのSUS材を用いた。また、振動膜51としては、厚みが1.5μmのPETフィルムに厚みが70nmのNiを蒸着したものを用い、20スペーサ40としては、厚みが38μmのPETを用いた。それぞれコンデンサマイクロホンに組上げ、感度を測定した。

測定の結果、実施例 5 のコンデンサセンサ 1 0 では、-3 7 d B ~ -3 0 d B という高感度が得られた。

そして、このコンデンサセンサ10に、図11に示すように振動を抑 25 制するためのエラストマ81及び導電性エラストマ82を装着し、図示 していない携帯電話の通常のマイクロホンに置き換えて複数の話者から

20

25

30cm程度離れたハンズフリー通話を行ったところ、通常のマイクロホンを備えた携帯電話では聞き取れない複数の人間の会話を、十分に聞き取ることが可能であることが実証された。なお、図11において、エラストマ81はゴムでも良く、導電性エラストマ82はバネでも良い。

5 次に、本実施の形態に係るコンデンサセンサの製造方法について説明 する。

図2に示すように、まず、絶縁部21を付けた導電性ケース20の内部に、エレクトレット材31を付けた固定電極30、スペーサ40、振動膜51を付けた振動膜保持部52、導電性部材53、回路実装基板60が順に挿入される。

次いで、回路実装基板60がカーリングやカシメで導電性ケース20の一部20bに圧接されることによって、固定電極30、エレクトレット材31、スペーサ40、振動膜51、振動膜保持部52、導電性部材53及び回路実装基板60が導電性ケース20の内部に固定される。

15 最後に、導電性面布 7 0 が導電性ケース 2 0 に接合されることによって、コンデンサセンサ 1 0 は組み立てられる。

なお、回路実装基板60は、IC回路がベアチップで実装されている場合、IC回路がパッケージで実装されている場合と比較して、振動膜51との間隔を小さくすることができるので、コンデンサセンサ10の高さを低くすることができる。したがって、回路実装基板60の実装としては、IC回路のベアチップ実装が好ましい。

ここで、図12(a)に示すように、FET61のベアチップの電極 形状は、裏面にドレイン61a及びソース61bを設け、図示していな い表面にゲートを設けた電極形状であっても良いし、図12(b)に示 すように、裏面にドレイン61a、ソース61b及びゲート61cを設 けた電極形状であっても良い。そして、それぞれの電極はスタットバン

プ、メッキバンプ又は半田ボールなど、通常のベアチップ実装に用いられる構造で実現できる。また、FET61のベアチップは、図12(a)に示す電極形状であるとき、裏面のドレイン61a及びソース61bを回路実装基板60上のランドにフリップチップ実装した後、表面のゲートを回路実装基板60の実装面にワイヤーボンディングなどを用いて接続する。また、FET61のベアチップは、図12(b)に示す電極形状であるとき、ドレイン61a、ソース61b及びゲート61cを回路実装基板60上のランドに同時にフリップチップ実装することができる。

そして、回路実装基板 6 0 は、例えば次のように I C 回路のベアチッ 10 プ実装が行われることによって製造される。

まず、図13(a)に示すような電極62aが形成されたガラエポやアルミナ基板などの基板62に、図13(b)に示すようにNCP(ノンコンダクティブペースト)やACP(アイソトロピーコンダクティブペースト)などのペースト63を塗布した後、図13(c)に示すように基板62に塗布されたペースト63の上から基板62にFET61のベアチップを熱によって高い位置決め精度で仮圧着する。ここで、基板62にペースト63を塗布する代りに、基板62にNCF(ノンコンダクティブフィルム)やACF(アイソトロピーコンダクティブフィルム)を貼り付けても良い。

- 20 次に、基板62に仮圧着されたFET61を、図13(d)に示すように、1個ずつ、又は、同時に複数個ずつ基板62に熱圧着装置91で 熱圧着することによってベアチップ実装を終える。ここで、FET61 を基板62に熱圧着する代りに、FET61を基板62に超音波接合などの熱圧着以外のベア実装プロセスを用いて接合しても良い。
- 25 次に、FET61が熱圧着された基板62に、図13(e)に示すよ うにクリーム半田64を印刷し、図13(f)に示すように、基板62

に印刷されたクリーム半田64の上から容量性素子、抵抗素子、誘導性素子、バリスタ素子などのチップ部品65を必要に応じて基板62に実装した後、図13(g)に示すように、基板62に実装したチップ部品65をリフローによって基板62に接合する。

5 最後に、以上のようにして製造された集合基板から図13(h)に示すように個別の回路実装基板60を抜き落とすことによって、回路実装基板60を製造する。ここで、例えば予め集合基板がプッシュバックなどで半抜き状態にある、又は予め個別に分離されていると、ベアチップの基板62に対する位置決め精度が低下してベアチップ実装の実装タクトが低下する。また、図13(g)に示すように製造された集合基板から個別の回路実装基板60の外周でのダストの発生が抑制され、歩留まりが向上する。

なお、図13に示す回路実装基板60の製造手順においては、FET 61の基板62へのベアチップ実装を、チップ部品65の基板62への 実装より先に行うようになっているが、チップ部品65の基板62への 実装を、FET61の基板62へのベアチップ実装より先に行うように なっていても良い。また、回路実装基板60は、チップ部品65に代え て、例えばポリイミドシート上にスパッタリングなど薄膜プロセスを用 いて容量性素子、抵抗素子又は誘導性素子を回路パターンとともに形成 20 したシートデバイスを備えるようになっていても良い。

また、図14(a)に示すように予め基板62に容量性素子、抵抗素子又は誘導性素子などの素子66が印刷又は薄膜プロセスによって形成されている場合、図13に示す場合と比較して、回路実装基板60と振動膜51との間隔を小さくすることができるので、コンデンサセンサ10は高さを低くすることができる。

ここで、図14(a)に示すように予め基板62に素子66が印刷又

は薄膜プロセスによって形成されている場合、回路実装基板 6 0 は次のように製造されることが望ましい。

まず、図14(a)に示すように予め素子66が印刷又は薄膜プロセスによって形成された基板62に、図14(b)に示すようにペースト63を塗布した後、図14(c)に示すように基板62に塗布されたペースト63の上から基板62にFET61のベアチップを熱によって高い位置決め精度で仮圧着する。ここで、基板62にペースト63を塗布する代りに、基板62にNCFやACFを貼り付けても良い。

次に、基板62に仮圧着されたFET61を、図14(d)に示すよ
10 うに、1個ずつ、又は、同時に複数個ずつ基板62に熱圧着装置91で
熱圧着することによってベアチップ実装を終える。ここで、FET61
を基板62に熱圧着する代りに、FET61を基板62に超音波接合な
どの熱圧着以外のベア実装プロセスを用いて接合しても良い。

最後に、以上のようにして製造された集合基板から図14(e)に示 15 すように個別の回路実装基板60を抜き落とすことによって、回路実装 基板60を製造する。

なお、回路実装基板60の構造としては、図13(h)や図14(e)に示す構造以外に、図15に示すようにFET61や素子66が内部に埋め込まれた構造であっても良い。回路実装基板60は、FET61や素子66を内部に埋め込んでいる場合、FET61や素子66が表面に実装される場合と比較して、振動膜51との間隔を小さくすることができるので、コンデンサセンサ10の高さを低くすることができる。

また、コンデンサセンサ10の内部に実装されるベアICは、FET 61のみならず、デジタル又はアナログのオーディオアンプ、音声認識 25 回路などをIC化して実装したものや、容量性素子や抵抗素子を同一の IC回路内に形成したものや、後述するような髙周波方式の回路をIC

10

20

化したものであっても良い。

なお、以上においては、コンデンサセンサ10は、固定電極30にエレクトレット材31が積層されているので、エレクトレットコンデンサマイクロホンとして機能することができるが、固定電極30及び振動膜51の何れにもエレクトレット材31が積層されていない構成であっても良い。コンデンサセンサ10は、固定電極30及び振動膜51の何れにもエレクトレット材31が積層されていない場合、図16に示すように、固定電極30及び振動膜51によって形成されるコンデンサの静電容量と、コイルの自己インダクタンスしとでの共振特性を利用することによって、高周波方式によるコンデンサマイクロホンとして機能することができる。なお、コンデンサセンサ10は、図16に示す回路10fが回路実装基板60にベアチップ実装されていても良い。

(第2の実施の形態)

まず、第2の実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成について説明する。なお、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成のうち、第1の実施の形態に係るコンデンサセンサ10(図1参照)の構成と同様な構成については、コンデンサセンサ10の構成と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。

図17に示すように、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサ100は、導電性ケース20の音孔20aが形成された面側にも固定電極30に接触する状態で絶縁部21を付している。

また、導電性ケース20と固定電極30との電気的接合は、レーザ溶接で生成された導通部11によって実現されている。

25 なお、絶縁部 2 1 が付された導電性ケース 2 0 は、例えば、絶縁樹脂が融着され、又は、塗布された積層金属シートをケース形状に絞り加工

10

25

されるだけで製造される。即ち、導電性ケース20は、ケース形状に絞り加工された後、音孔20 a が形成された面側の絶縁部21をプラスト工法などを適用して除去する必要が無い。したがって、コンデンサセンサ100は、コンデンサセンサ10と比較して容易に製造することができる。

次に、本実施の形態に係るコンデンサセンサの製造方法について説明 する。

まず、絶縁部21を付けた導電性ケース20の内部に、エレクトレット材31を付けた固定電極30、スペーサ40、振動膜51を付けた振動膜保持部52、回路実装基板60が順に挿入される。

次いで、回路実装基板60がカーリングやカシメで導電性ケース20の一部20bに圧接されることによって、固定電極30、エレクトレット材31、スペーサ40、振動膜51、振動膜保持部52及び回路実装基板60が導電性ケース20の内部に固定される。

15 最後に、導電性ケース20と、固定電極30とがレーザ溶接で生成された導通部11によって接合された後、導電性面布70が導電性ケース20に接合されることによって、コンデンサセンサ100は組み立てられる。

なお、コンデンサセンサ100は、コンデンサセンサ10のように、
20 振動膜保持部52及び回路実装基板60の間に導電性部材53(図2参
照)を設けることによって髙さの調整を容易化することができる。

また、コンデンサセンサ100は、レーザ溶接によって導通部11を 生成する代りに、例えば固定電極30に予め設けられた突起で組立て時 に絶縁部21を突き破ることによって導通部を生成したり、半田付けに よって導通部を生成したりすることによって、導電性ケース20及び固 定電極30の間の電気的接合を実現することができる。固定電極30に 予め設けられた突起で導電性ケース20及び固定電極30の電気的接合を実現する場合、レーザ溶接を施すことによって導電性ケース20及び固定電極30の電気的接合を実現する場合と比較して、コンデンサセンサ100は容易に製造される。

5 (第3の実施の形態)

15

まず、第3の実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成について説明する。なお、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成のうち、第1の実施の形態に係るコンデンサセンサ10(図1参照)の構成と同様な構成については、コンデンサセンサ10の構成と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。

図18に示すように、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサ110の構成は、導電性ケース20に付されていた絶縁部21 (図1参照)に代えて導電性ケース20とは独立した絶縁部111を導電性ケース20及び振動膜保持部52の間にコンデンサセンサ10が備えた構成と同様である。

ここで、固定電極30及び振動膜51の面積を大きくして固定電極30と振動膜51との静電容量を大きくために、絶縁部111は、必然的に薄くする必要がある。一方、機械による自動的な実装上の課題から、20 絶縁部111は、ある程度の剛性をもつ必要がある。したがって、絶縁部111の材料としては、AS(アクリロニトリルスチレン共重合体)、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体)、PMMA(メタクリル酸メチル)、POM(ポリアセタール)、PBT(ポリプチレンテレフタレート)、PP、PS(ポリスチレン)、PET、PC(ポリカーボネイド)、PPA(ポリフタルアミド)、PPS、PI(ポリイミド)、LCP(液晶ポリマー)などが比較的好ましいが、絶縁部111に強い

剛性を持たせるためにはこれらの樹脂とガラスとの複合体や、これらの 樹脂と金属の複合体が特に好ましい。例えば、絶縁部111は、SUS を母材として、母材であるSUSの周囲に絶縁物の塗布加工などを施し た複合体などによって構成されることが好ましい。

5 なお、コンデンサセンサ110は、絶縁部21が導電性ケース20に付されたコンデンサセンサ10と比較して部品点数が増加する。しかしながら、コンデンサセンサ110は、コンデンサセンサ10と比較して、簡単な構造であり、容易に製造されることができるので、導電性ケース20に絶縁部21を付さなくても良い分だけ製造工程を減少することができ、製造コストを低下させることができる。

次に、本実施の形態に係るコンデンサセンサの製造方法について説明 する。

まず、導電性ケース20の内部に、絶縁部111、エレクトレット材31を付けた固定電極30、スペーサ40、振動膜51を付けた振動膜保持部52、回路実装基板60が順に挿入される。

次いで、回路実装基板60がカーリングやカシメで導電性ケース20の一部20bに圧接されることによって、固定電極30、エレクトレット材31、スペーサ40、振動膜51、振動膜保持部52及び回路実装基板60が導電性ケース20の内部に固定される。

20 最後に、導電性面布 7 0 が導電性ケース 2 0 に接合されることによって、コンデンサセンサ 1 1 0 は組み立てられる。

なお、コンデンサセンサ110は、コンデンサセンサ10のように、 振動膜保持部52及び回路実装基板60の間に導電性部材53(図2参 照)を設けることによって髙さの調整を容易化することができる。

25 (第4の実施の形態)

15

まず、第4の実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデン

明を省略する。

5

サセンサの構成について説明する。なお、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成のうち、第3の実施の形態に係るコンデンサセンサ110(図18参照)の構成と同様な構成については、コンデンサセンサ110の構成と同一の符号を付して詳細な説

図19に示すように、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサ120は、固定電極30、スペーサ40及び絶縁部111の大きさだけがコンデンサセンサ110と異なるだけである。

次に、本実施の形態に係るコンデンサセンサの製造方法について説明 10 する。

まず、導電性ケース20の内部に、エレクトレット材31を付けた固定電極30、スペーサ40、絶縁部111、振動膜51を付けた振動膜保持部52、回路実装基板60が順に挿入される。

次いで、回路実装基板 6 0 がカーリングやカシメで導電性ケース 2 0 15 の一部 2 0 b に圧接されることによって、固定電極 3 0 、エレクトレット材 3 1 、スペーサ 4 0 、振動膜 5 1 、振動膜保持部 5 2 及び回路実装基板 6 0 が導電性ケース 2 0 の内部に固定される。

最後に、導電性面布70が導電性ケース20に接合されることによって、コンデンサセンサ120は組み立てられる。

- 20 コンデンサセンサ120は、固定電極30と比較して薄くて軽いスペーサ40が絶縁部111より先に導電性ケース20の内部に挿入されるので、スペーサ40が導電性ケース20の内部に挿入されるときにスペーサ40が絶縁部111に引っ掛かることが無く、コンデンサセンサ110と比較して容易に製造されることができる。
- 25 一方、コンデンサセンサ110は、コンデンサセンサ120と比較し て固定電極30及びスペーサ40を小さくすることができるので、コン

デンサセンサ120と比較して材料コストを下げることができる。

なお、コンデンサセンサ120は、コンデンサセンサ110のように、 振動膜保持部52及び回路実装基板60の間に導電性部材53(図2参 照)を設けることによって高さの調整を容易化することができる。

5 (第5の実施の形態)

10

15

20

まず、第5の実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成について説明する。なお、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成のうち、第1の実施の形態に係るコンデンサセンサ10(図1参照)の構成と同様な構成については、コンデンサセンサ10の構成と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。

図20に示すように、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサ130の構成は、導電性ケース20と固定電極30との間に配置された導電性スペーサ131をコンデンサセンサ10が備えた構成と同様である。

また、コンデンサセンサ130は、導電性ケース20の音孔20aの形状もコンデンサセンサ10と異なっている。即ち、コンデンサセンサ130においては、固定電極30の音孔30aの全部が導電性ケース20の音孔20a以外の部分と対向している。換言すると、コンデンサセンサ130においては、固定電極30の音孔30aと、導電性ケース20の音孔20aとが全く対向していない。例えば、コンデンサセンサ130が円柱の形状をとっている場合、導電性ケース20は、図21に示すように音孔20aが形成されている。

なお、導電性スペーサ131は、強度と導電性の点から金属であるこ 25 とが望ましい。

ここで、コンデンサセンサ130は、導電性ケース20及び固定電極

10

20

25

30が互いに直接接触しているコンデンサセンサ10と比較して、導電性ケース20の音孔20aが形成された面から固定電極30までの距離が長いので、導電性ケース20の外部の電磁ノイズが振動膜51に到達して振動膜51に影響することを抑制することができる。

また、コンデンサセンサ130は、固定電極30の音孔30aと、導電性ケース20の音孔20aとが全く対向していないので、固定電極30の音孔30aの音孔20aと対向しているコンデンサセンサ10と比較して、導電性ケース20の外部の電磁ノイズが振動膜51に到達して振動膜51に影響することを抑制することができる。

以上に説明したように、コンデンサセンサ130は、導電性ケース20の外部の電磁ノイズが振動膜51に到達して振動膜51に影響することを抑制することができるので、例えば、導電性面布70に代えて、導電性面布70より安価な非導電性面布を備えることができる。

15 次に、本実施の形態に係るコンデンサセンサの製造方法について説明 する。

まず、絶縁部21を付けた導電性ケース20の内部に、導電性スペーサ131、エレクトレット材31を付けた固定電極30、スペーサ40、振動膜51を付けた振動膜保持部52、回路実装基板60が順に挿入される。

次いで、回路実装基板60がカーリングやカシメで導電性ケース20の一部20bに圧接されることによって、導電性スペーサ131、固定電極30、エレクトレット材31、スペーサ40、振動膜51、振動膜保持部52及び回路実装基板60が導電性ケース20の内部に固定される。

最後に、導電性面布70が導電性ケース20に接合されることによっ

て、コンデンサセンサ130は組み立てられる。

なお、コンデンサセンサ130は、コンデンサセンサ10のように、 振動膜保持部52及び回路実装基板60の間に導電性部材53 (図2参 照)を設けることによって髙さの調整を容易化することができる。

5 (第6の実施の形態)

10

15

20

まず、第6の実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成について説明する。なお、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成のうち、第4の実施の形態に係るコンデンサセンサ120(図19参照)の構成と同様な構成については、コンデンサセンサ120の構成と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。

図22に示すように、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサ140の構成は、導電性ケース20と固定電極30との間に導電性スペーサ131をコンデンサセンサ120が備えた構成と同様である。

また、コンデンサセンサ140は、導電性ケース20の音孔20aの形状もコンデンサセンサ120と異なっている。即ち、コンデンサセンサ140においては、固定電極30の音孔30aの全部が導電性ケース20の音孔20a以外の部分と対向している。換言すると、コンデンサセンサ140においては、固定電極30の音孔30aと、導電性ケース20の音孔20aとが全く対向していない。

なお、導電性スペーサ131は、強度と導電性の点から金属であることが望ましい。

ここで、コンデンサセンサ140は、導電性ケース20及び固定電極 25 30が互いに直接接触しているコンデンサセンサ120と比較して、導 電性ケース20の音孔20aが形成された面から固定電極30までの距

離が長いので、導電性ケース 2 0 の外部の電磁ノイズが振動膜 5 1 に到 達して振動膜 5 1 に影響することを抑制することができる。

また、コンデンサセンサ140は、固定電極30の音孔30aと、導電性ケース20の音孔20aとが全く対向していないので、固定電極30の音孔30aの音孔20aと対向しているコンデンサセンサ120と比較して、導電性ケース20の外部の電磁ノイズが振動膜51に到達して振動膜51に影響することを抑制することができる。

以上に説明したように、コンデンサセンサ140は、導電性ケース2 10 0の外部の電磁ノイズが振動膜51に到達して振動膜51に影響することを抑制することができるので、例えば、導電性面布70に代えて、導電性面布70より安価な非導電性面布を備えることができる。

次に、本実施の形態に係るコンデンサセンサの製造方法について説明 する。

まず、導電性ケース20の内部に、導電性スペーサ131、エレクトレット材31を付けた固定電極30、スペーサ40、絶縁部111、振動膜51を付けた振動膜保持部52、回路実装基板60が順に挿入される。

次いで、回路実装基板60がカーリングやカシメで導電性ケース20
 の一部20bに圧接されることによって、導電性スペーサ131、固定電極30、エレクトレット材31、スペーサ40、振動膜51、振動膜保持部52及び回路実装基板60が導電性ケース20の内部に固定される。

最後に、導電性面布 7 0 が 導電性ケース 2 0 に接合されることによっ 25 て、コンデンサセンサ 1 4 0 は組み立てられる。

なお、コンデンサセンサ140は、コンデンサセンサ120のように、



振動膜保持部52及び回路実装基板60の間に導電性部材53 (図2参照)を設けることによって高さの調整を容易化することができる。

(第7の実施の形態)

まず、第7の実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成について説明する。なお、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサの構成のうち、第1の実施の形態に係るコンデンサセンサ10(図1参照)の構成と同様な構成については、コンデンサセンサ10の構成と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。

- 10 図23に示すように、本実施の形態に係るフロントエレクトレット型のコンデンサセンサ150は、導電性ケース20が互いに対向した一対の開口部23a及び23bを有しており、導電性面布70が固定電極30の音孔30aを直接覆っているところが、コンデンサセンサ10と異なる。
- 15 なお、コンデンサセンサ150は、コンデンサセンサ10の対向部2 2b(図1参照)のように固定電極30を覆う部分を導電性ケース20 が有していないので、導電性ケース20の変形による周波数特性の悪化 を抑制することができる。

次に、本実施の形態に係るコンデンサセンサの製造方法について説明 20 する。

まず、絶縁部21を付けた導電性ケース20の内部に導電性ケース20の開口部23aを介して、エレクトレット材31を付けた固定電極30が圧入された後、スペーサ40、振動膜51を付けた振動膜保持部52、回路実装基板60が順に挿入される。

25 次いで、回路実装基板 6 0 がカーリングやカシメで導電性ケース 2 0 の一部 2 0 b に圧接されることによって、エレクトレット材 3 1 、スペ

ーサ40、振動膜51、振動膜保持部52及び回路実装基板60が固定 電極30及び導電性ケース20の内部に固定される。

最後に、導電性面布70が固定電極30に接合されることによって、 コンデンサセンサ150は組み立てられる。

5 なお、コンデンサセンサ150は、コンデンサセンサ10のように、 振動膜保持部52及び回路実装基板60の間に導電性部材53(図2参照)を設けることによって高さの調整を容易化することができる。

産業上の利用の可能性

10 本発明によれば、周波数特性の悪化を抑制することができるコンデン サセンサを提供することができる。

請求の範囲

- 1. 開口部及び前記開口部に対向した対向部を有した導電性ケースと、前記開口部を介して前記導電性ケースの内部に収納された固定電極と、前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極より前記開口部側に前記固定電極と離隔して配置された導電性の振動膜と、前記導電性ケースの内部に収納され前記版動膜を保持した導電性の振動膜保持部と、前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極及び前記振動膜とそれぞれ前記導電性ケース及び前記振動膜保持部を介して電気的に接続された回路実装基板と、前記対向部の変形を抑制する変形抑制部とを備え、
- 前記変形抑制部は、前記導電性ケース及び前記振動膜の間であって前 記振動膜の振動可能な部分の外周より内側に配置されたことを特徴とす るコンデンサセンサ。
- 2. 前記固定電極及び前記変形抑制部は、一体に形成されたことを特徴 2. もする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
 - 3. 前記振動膜は、導電性物質が積層された樹脂フィルムを有したことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 20 4. 前記振動膜保持部は、導電体及び絶縁体の複合体であることを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 5. 前記導電性ケース及び前記固定電極は、それぞれ音孔が形成され、 前記導電性ケースの前記音孔の総面積は、前記固定電極の前記音孔の 25 総面積より大きく、

前記固定電極の前記音孔の総面積は、前記振動膜の振動可能な部分の

総面積の1/1000より大きく1/10より小さいことを特徴とする 請求項1に記載のコンデンサセンサ。

- 6. 前記振動膜の厚みは、1 μ mより大きく3 μ mより小さいことを特6 徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
 - 7. 前記振動膜の基本共振周波数は、10KHzより大きく35KHz より小さいことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 10 8. 前記固定電極に付されたエレクトレット材を備え、 前記エレクトレット材の厚みは、3 μ m より大きく2 5 μ m より小さ いことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 9. 前記導電性ケースに取り付けられて前記導電性ケースと電気的に接 続された導電性面布を備え、

前記導電性ケース及び前記固定電極は、それぞれ音孔が形成され、 前記導電性ケースの音孔は、前記導電性面布によって覆われたことを 特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。

- 20 10. 前記導電性面布は、導電性物質及び非導電性物質の複合体であることを特徴とする請求項9に記載のコンデンサセンサ。
 - 11. 前記導電性ケース及び前記固定電極の間に配置された導電性スペーサを備え、
- 25 前記導電性ケース及び前記固定電極は、それぞれ音孔が形成されたことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。

12. 前記固定電極の前記音孔の少なくとも一部は、前記導電性ケースの前記音孔以外の部分と対向したことを特徴とする請求項11に記載のコンデンサセンサ。

5

- 13. 前記固定電極は、前記振動膜と外周部の形状が異なることを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 14. 前記導電性ケースの前記振動膜保持部側の面に付された絶縁部を 10 備えたことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
 - 15. 前記導電性ケース及び前記振動膜保持部の間に絶縁部を備え、 前記絶縁部は、前記導電性ケースとは独立していることを特徴とする 請求項1に記載のコンデンサセンサ。

15

- 16. 前記絶縁部は、金属の母材と、前記母材の表面に施された絶縁材料との複合体であることを特徴とする請求項15に記載のコンデンサセンサ。
- 20 17. 前記振動膜保持部と前記回路実装基板との間に配置された導電性 部材を備え、

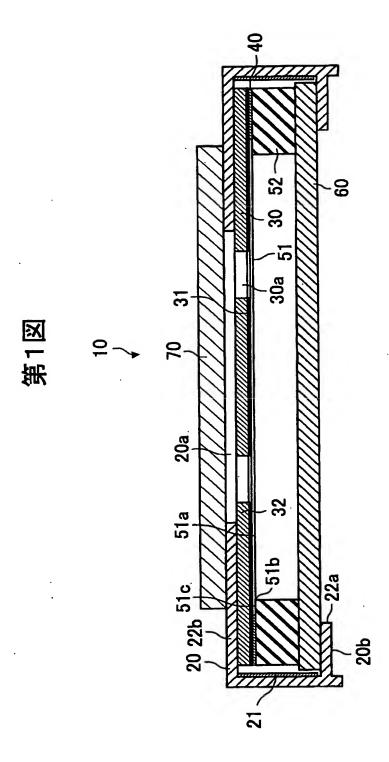
前記回路実装基板は、前記導電性部材を介して前記振動膜保持部と電気的に接続されたことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。

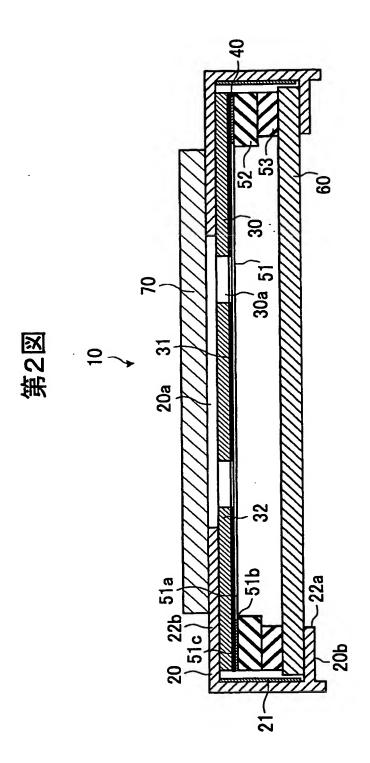
25 18. 外部の機器と電気的に接続可能な端子と、前記端子に電気的に接続されノイズを除去するノイズ除去部とを有し、

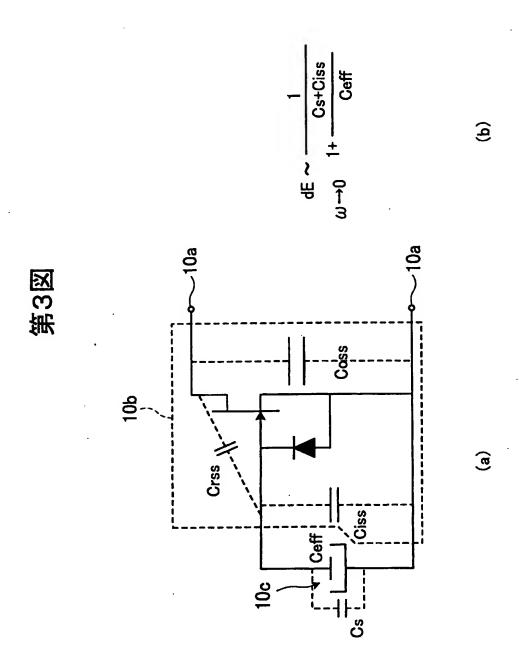
前記ノイズ除去部は、前記回路実装基板に実装されたことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。

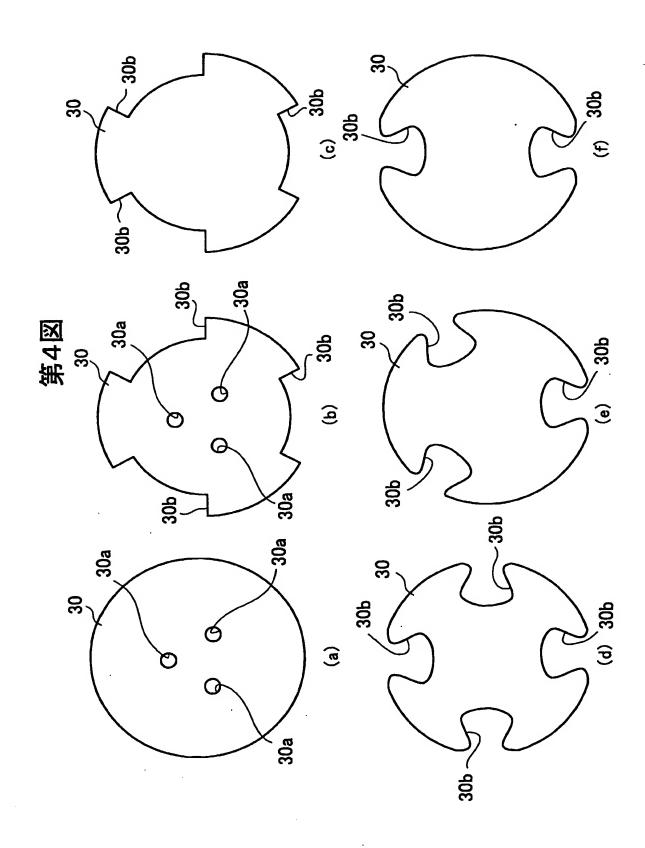
- 19. 前記端子に電気的に接続され前記回路実装基板に実装されたバリ スタ素子を備えたことを特徴とする請求項18に記載のコンデンサセンサ。
 - 20. 前記回路実装基板の内部に埋め込まれた素子を備えたことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
 - 21. 印刷及び薄膜プロセスの少なくとも一方によって前記回路実装基板上に形成された素子を備えたことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 15 22. 前記回路実装基板上に実装されたベアチップを備えたことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 23. 前記導電性ケースの前記固定電極側の面に付された絶縁部と、前 記導電性ケース及び前記固定電極の間を電気的に接続した導通部とを有 20 したことを特徴とする請求項1に記載のコンデンサセンサ。
- 24. 互いに対向した一対の開口部を有した導電性ケースと、前記開口部を介して前記導電性ケースに圧入された固定電極と、前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極と離隔して配置された導電性の振動膜 25 と、前記導電性ケースの内部に収納され前記振動膜を保持した導電性の振動膜保持部と、前記導電性ケースの内部に収納され前記固定電極及び

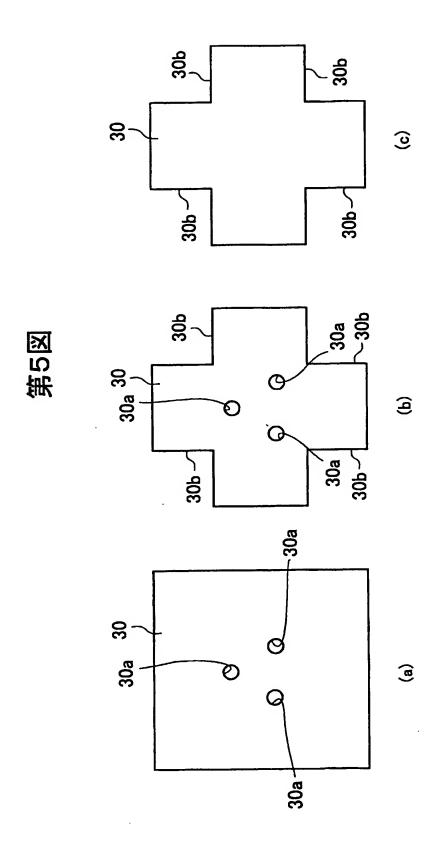
前記振動膜とそれぞれ前記導電性ケース及び前記振動膜保持部を介して電気的に接続された回路実装基板とを備えたことを特徴とするコンデンサセンサ。

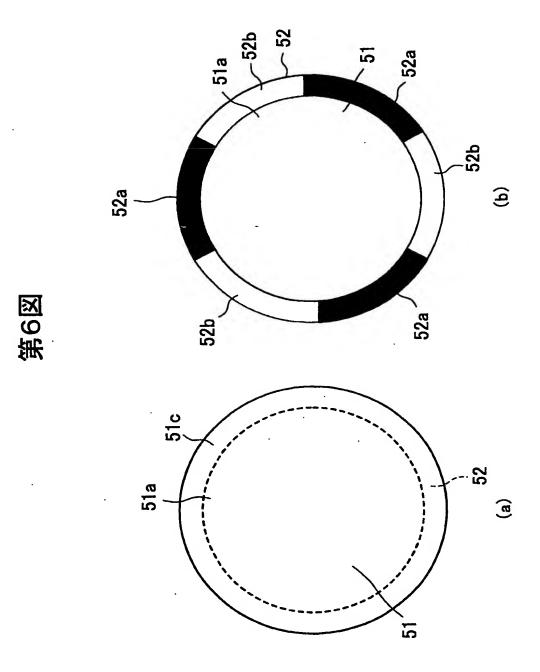


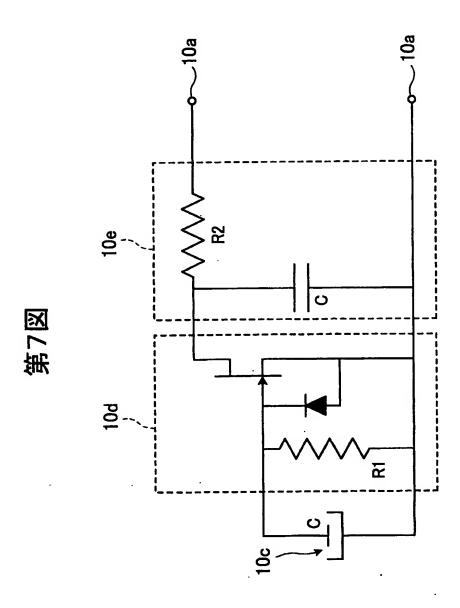


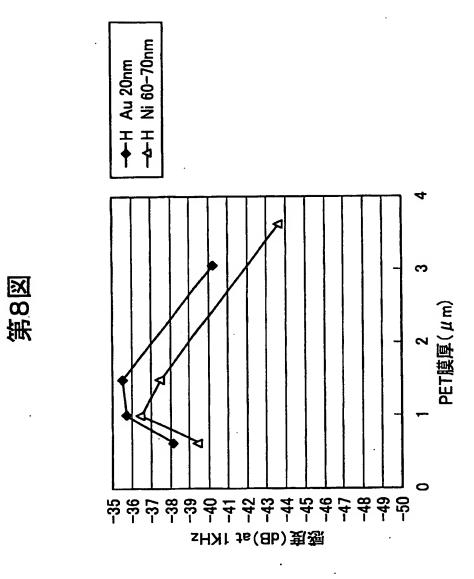




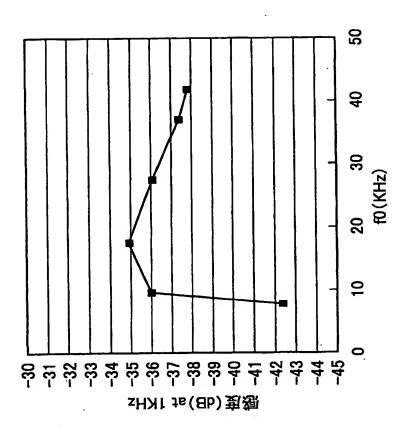


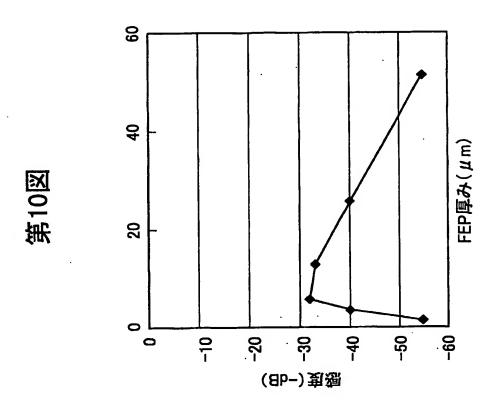


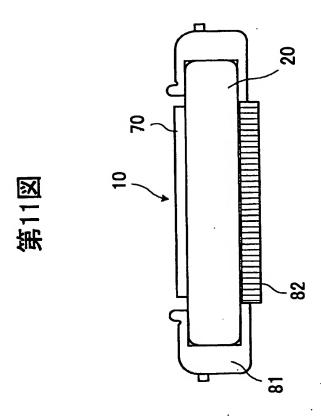


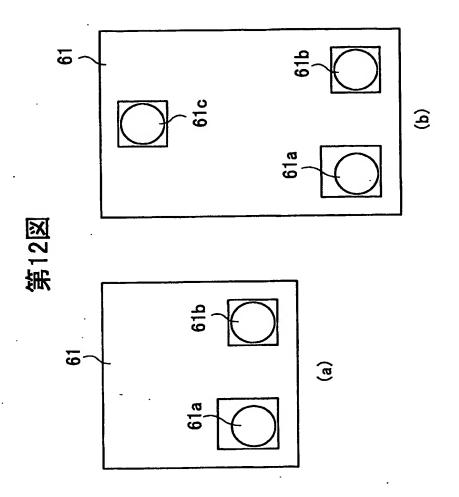


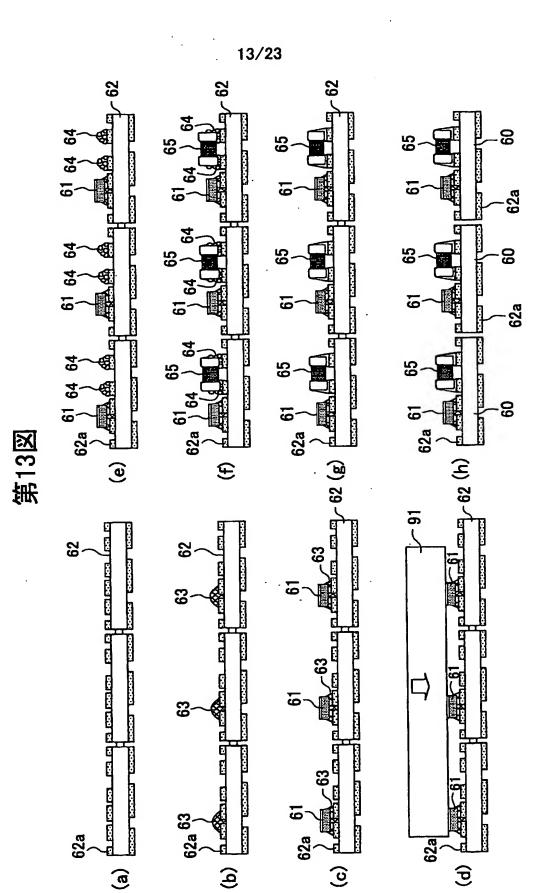
第9図

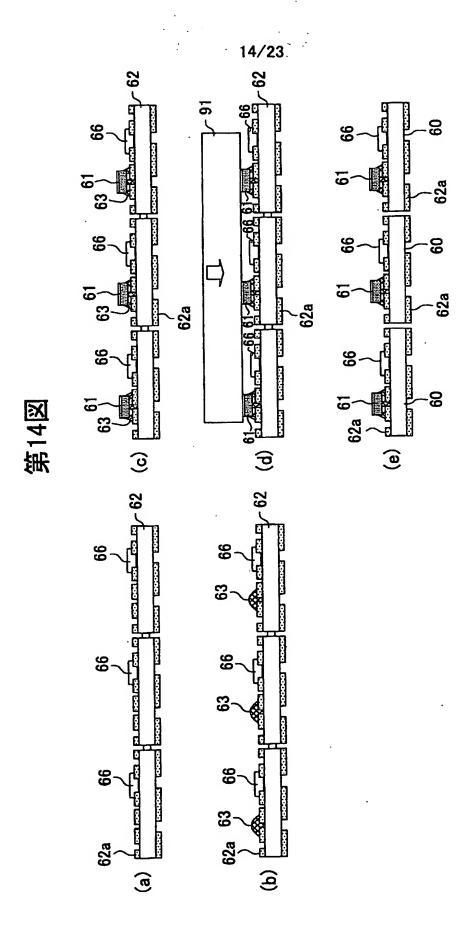




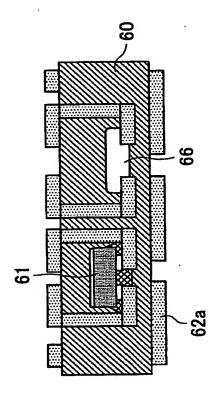


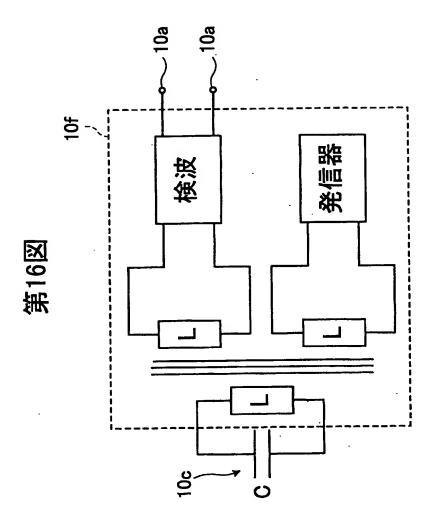


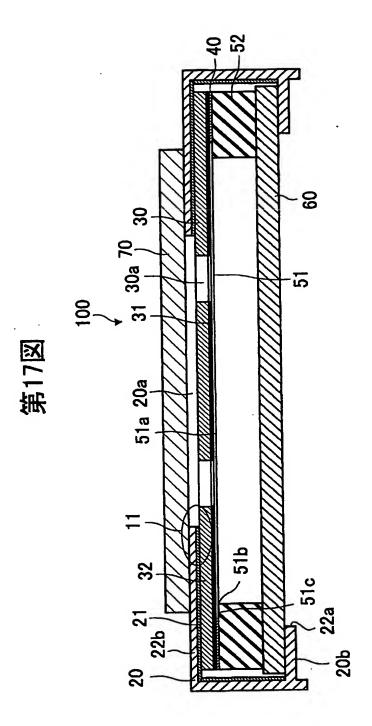


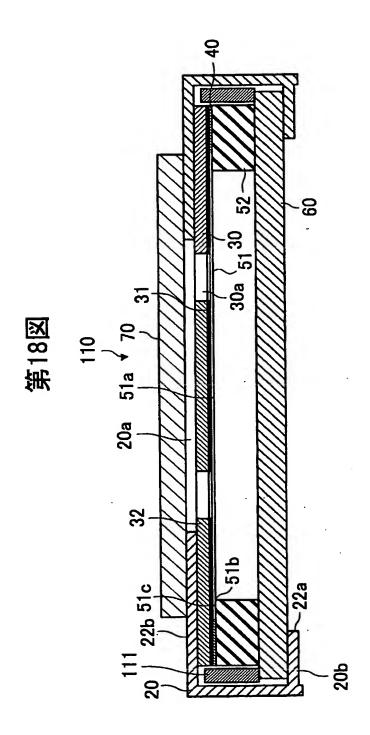


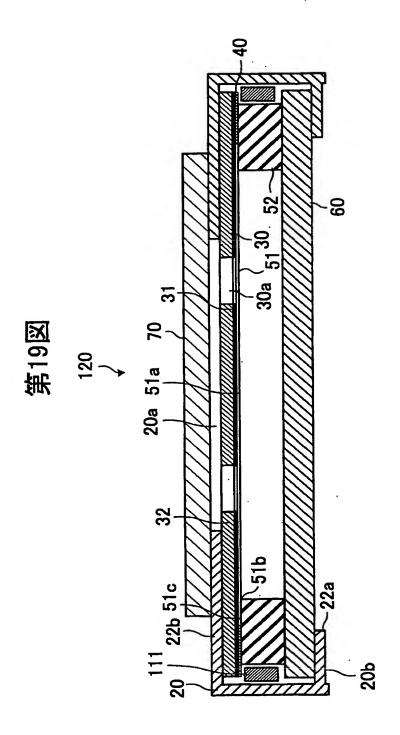


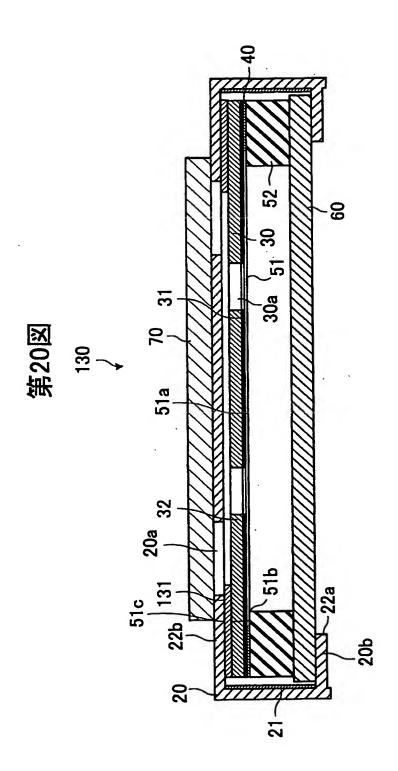


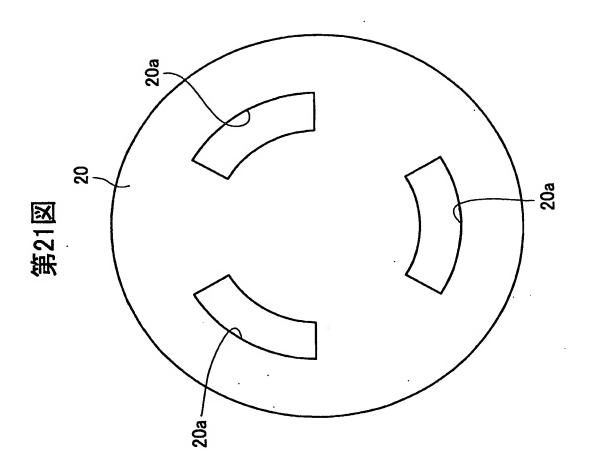


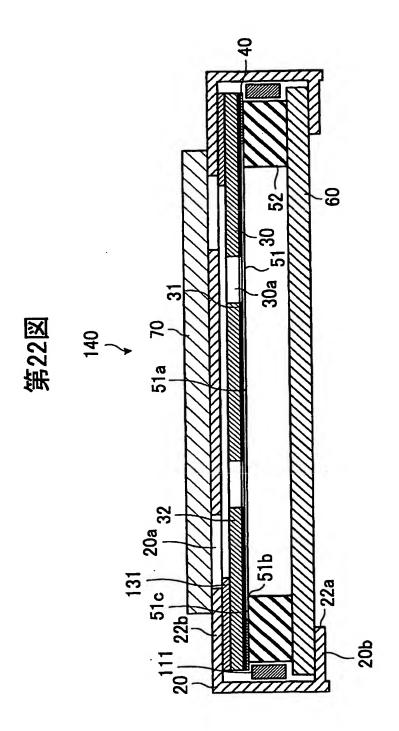




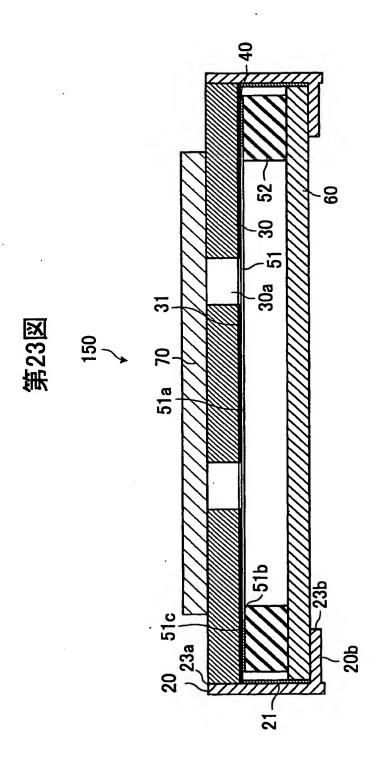


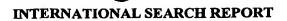






23/23







International application No.
PCT/JP03/04328

A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ H04R19/01		
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H04R19/01			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched
Tite	Jitsuyo Shinan Koho1922-1996Toroku Jitsuyo Shinan Koho1994-2003Kokai Jitsuyo Shinan Koho1971-2003Jitsuyo Shinan Toroku Koho1996-2003		
	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 61-247199 A (Matsushita C Industrial Co., Ltd.),		1-3 4-24
	04 November, 1986 (04.11.86), Page 1, right column; page 2, Fig. 4 (Family: none)		
X Y	JP 2000-115895 A (Hoshiden K 21 April, 2000 (21.04.00), Par. Nos. [0066] to [0068]; E (Family: none)		1-2,24 3-23
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Specia "A" docum	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte	he application but cited to
"E" earlier	considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention earlier document but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot b		claimed invention cannot be
cited to	considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be		claimed invention cannot be
"O" docum	and the state of t		documents, such
means combination being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search 25 June, 2003 (25.06.03) Date of mailing of the international search 08 July, 2003 (08.07.03)			
	nailing address of the ISA/	Authorized officer	
Japa	nese Patent Office		•
Facsimile No.		Telephone No.	_



International application No.
PCT/JP03/04328

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	CD-ROM of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 26840/1991 (Laid-open No. 96199/1992) (Hoshiden Kabushiki Kaisha), 20 August, 1992 (20.08.92), Par. Nos. [0002], [0005], [0007], [0013], [0017]; Figs. 4 to 6 (Family: none)	1-2,5-6,8,24 3-4,7,9-23
X Y	JP 11-266499 A (Hoshiden Kabushiki Kaisha), 28 September, 1999 (28.09.99), Par. Nos. [0002], [0006], [0008], [0020]; Fig. 3 (Family: none)	1,14-16,18, 22 2-11,17, 19-21,23-24
Y	JP 2001-352596 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 21 December, 2001 (21.12.01), Par. No. [0020]; all drawings & US 2002/3412 A1	19
Y	JP 2001-112094 A (Sanyo Electric Co., Ltd., Hoshiden Kabushiki Kaisha), 20 April, 2001 (20.04.01), Full text; Fig. 2 & CN 1291066 A	20-21



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		•	
A. 発明の風する分野の分類(国際代計分類(IFC))	,		
		•	
Int. Cl' H04R19/01	·		
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))			
		·	
Int. Cl' H04R19/01			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
市内では対象のは対象のは、		·	
日本国公開実用新案公報 1971-2003年			
日本国登録実用新案公報 1994-2003年			
日本国実用新案登録公報 1996-2003年			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
	·		
C. 関連すると認められる文献		J. ,	
引用文献の		関連する	
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		請求の範囲の番号	
X JP 61 - 247199 A (松下通信工業株	式会社) 1986.11.04	1-3	
Y 第1頁右欄,第2頁左下欄,第4図	(ファミリーなし)	4-24	
X JP 2000 - 115895 A (ホシデン株式	·스牡) 2000 04 21	1-2, 24	
X JP 2000 - 115895 A (ホシテン株式 Y 【0066】 - 【0068】段落,第2図	(ファミリーなし)	3-23	
1 [0000] [0000] [2747, 33223			
х 日本国実用新案登録出願3-26840号	(日本国実用新案登録出願公開4	1-2, 5-6, 8, 24	
v −96199号)の願書に添付した明細書	及び図面の内容を記録したCD -	3-4, 7, 9-23	
ROM (ホシデン株式会社) 1992.08.20), [0002] [0005] [0007]		
【0013】【0017】段落,第4-6図(フ	アミリーなし)		
	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照	
区欄の続きにも文献が列挙されている。	一 ハックトングミットに関するが	1100	
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献	the terretainst of	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、	発明の原理又は理論	
もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの		
以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考	当該文献のみで発明 きられるもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以	
文献(理由を付す)	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに	
「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	\$ B 00	
11] 国外国際日間で、70 と思う時に、これ			
国際調査を完了した日			
25. 06. 03			
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	5 C 7254	
日本国特許庁(ISA/JP)	松澤福三郎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	,	
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3540		内線 3540	
NISTABLE I TAMBLE IN THE THE TAMBLE IN THE T			

国際調金	is ±u	Æ
四欧州	≖77 0	

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の	関連する	
カテゴリー*		請求の範囲の番号
X	JP 11-266499 A (ホシデン株式会社) 1999.09.28	1, 14–16, 18
·	【0002】【0006】【0008】【0020】段落,第3図(ファミリーな	22
Y	し)	2-11, 17, 19
		-21, 23-24
Y	JP 2001-352596 A (松下電器産業株式会社) 2001.12.21	19
I	[0020] 段落, 全図 & US 2002/3412 A1	
	[0020] 秋雅, 王四 & 00 2002/0312 111	
Y	JP 2001-112094 A (三洋電機株式会社, ホシデン株式会社)	20-21
•	2001.04.20, 全文,第2図 & EP 1091618 A2 & CN 1291066	
	A	
		1
1		
1		1
]
1		
	,	
	,	
1	·	
		_1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.

Defects in the images merade out the not immitted to the items effected.	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.